# LIQUID JET HEAD AND MANUFACTURE THEREOF

Publication number: JP2251457 (A) Publication date: 1990-10-09

HASEGAWA KAZUMASA Inventor(s): Applicant(s): SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international: B41J2/045; B41J2/055; B41J2/16; B41J2/045; B41J2/055; B41J2/16; (IPC1-

7): B41J2/045; B41J2/16

- European:

Application number: JP19890074213 19890327 Priority number(s): JP19890074213 19890327

## Abstract of JP 2251457 (A)

PURPOSE: To obtain a liquid jet head capable of easily densifying nozzles and of easily making multinozzles by a method wherein the title liquid jet head is composed of a piezoelectric film provided on an optional substrate and a hole provided in the piezoelectric film. CONSTITUTION:A hole forming pattern 102 is formed on a substrate 101, and a first piezoelectric film 103 is formed over the substrate. A hole 104 is formed by removing the hole forming pattern 102. Materials such as PZT or the like are used for the piezoelectric film, and the hole forming pattern is formed by organic resin, which is removed by heat treatment. A hole 104 serving as a conduit path of liquid of a liquid let head when the hole is formed, and a hole 108 serving as a pressure chamber are formed in a line state.: Thereafter, an electrode 105, a second piezoelectric film 106, and an electrode 107 are formed, and a piezoelectric element is formed. Materials of Pt or the like are used for the electrodes 105 and 107, which are formed on the pressure chamber 108. Since the liquid conduit path, the piezoelectric element, etc., are continuously formed for a liquid let head to be thus formed, densification of nozzles and nozzle multiplication become easy to perform.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

## 19 日本国特許庁(JP)

11) 特許出願公開 平2-251457

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

冗發 明 者

和出 頭 人

識別記号

43公開 平成2年(1990)10月9日

B 41 J 2/045 2/16 庁内整理番号

B 41 J 3/04 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称 液体噴射ヘッド及びその製造方法

②特 顧 平1-74213

②出 顧 平1(1989)3月27日

長谷川 和正

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

セイコーエブソン株式

1. 発明の名称

液体噴射ヘッド及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1)少なくとも、 任意の基板上に設けた圧電 膜、及び前記圧電膜中に設けた空孔より成ること を特徴とする、液体噴射ヘッド。
- (2)少なくとも、 空孔形成パターン形成工程、 圧電膜形成工程、 及び前記空孔形成パターンを取 り除くことにより空孔を形成する工程を有するこ とを特徴とする、液体噴射ヘッドの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本見明は、インクジェットプリンタ等に用いら れる液体噴射ヘッド、特に圧電素子を用いた液体 噴射ヘッド及びその製造方法に関する。

#### 「従来の技術」

從来のインクジェットプリンタにおける液体噴 射ヘッドは、小林正人他(頭像電子学会誌12巻 4 号 p p. 277~284, 1983) 郷に示さ れるごとく、基板と鉄基板に対向して設ける可動 板により、圧力室やインク導道路等を形成してい た。また、空孔形成技術を利用した液体暗射へっ FELTIL K. Utsumi et al. ( International Microele ctronics Conference 19 86 Proceedings, Kobe, Ma y 28~30, pp. 36~42, 1986) 等に示されるごとく、 積層 セラミックを用いて形 成したものがある。

## [発明が解決しようとする課題]

従来の、基板と可動板により成る液体噴射へっ ドにおいては、 該可動板に圧電素子を貼り付けて いたため、該圧電素子を微細化することが困難で あり、 このため液体噴射を行うノズルの高密度化 や、ノズルをラインはに長尺に形成するマルチノ ズル化が困難であった。また、復居セラミックに 空孔形成技術を用いて形成した液体噴射ペット いいては、空孔形成パターンと圧電素子電板との 位置すれが容易に生い、低歩倒りであった。

本発明は以上の課題を解決するもので、その目的とするところは、ノズルの高密度化やマルチノズル化が容易であり、更に高歩智りで形成できる 液体理制ヘッドを来現することにある。

#### [課題を解決するための手段]

以上述べた課題を解決するため、本発明の液体け 項 射へッドは、 少なくとも、 任 至の 高版上に設け た 正 電版、 及び前記圧電 額中に設けた空礼を以ます。 っドの製造方法は、 少なくとも、 空礼形成パター ン形成工程、 圧電線形成工程、 及び前記空礼形成 パターンを取り除くことにより空礼を形成する エ 理 本有することを特徴とする。

0, pp. 36~42, 1986) に示されてい るごとく、有機樹脂で形成し、熱処理により取り 除けばよい。また、Al等の金属膜をパターニン グすることにより空孔形成パターンを形成し、エ ッチングにより零孔を形成してもよく。 また. A u Cl. やTeO: 等のごとき数百度で昇華する 物質を用いて空孔形成パターンを形成し. 熱処理 を行い空孔を形成してもよい。空孔を形成したと きの液体増射ヘッドの平面図は第1図(d)のご とくなり、液体の導道路となる空孔104や、圧 力なとなる空孔108がライン状に形成される。 その後、 電板105、 第2の圧電器106、 電板 107と形成し、 第1図(c)のごとき新面図と なる。105万至107により圧電素子が形成さ れる。 電極105及び107はPt等の材料を用 いればよく。 第1図 (d) に示す圧力率108上 に形成される。 この様にして形成される液体噴射 ヘッドは、フォトリソグラフィー技術を用いて液 体進通路や圧電素子等を連続的に形成しているた め、ノズルの高密度化やマルチノズル化が容易と

## [実施例]

第1図(a)~(c)に、本発明の実施例にお ける液体噴射ヘッドの製造工程順の断面図を示す。 問題(a)は零孔形成パターン形成工程終了時 (b) は空孔形成工程終了時、(c) は液体噴射 ヘッド完成時の斯面図である。また、同図(d) は周囚(b)の空孔形成工程終了時における液体 噴射ヘッドの平面図の例である。 まず任意の基板 101上に空孔形成パターン102を形成し、第 1 個 (a) に示すごと表析面関となる。 1 0 2 は. 液体を噴射するノズルのパターンの断面図を示し ている。そして、第1の圧電器103を全面に形 成し、空孔形成パターン102を取り除くことに より空孔104を形成し、第1図(b)に示すご とき斯面図となる。 圧電膜には、 PZT等の材料 を用いればよい。 そして空孔形成パターンには K. Utsumi et al. (Intern ational Microelectroni cs Conference 1988 Pro ceedings, Kobe, May 28~3

第2回に、本発明の実施例における。 圧電素子 電極を一層で形成した液体環射へッドの遊体等適 路に治った新国を示す。 同回において、第20 1 は圧電銀があり、202は液体環射、203 は液体供給孔である。第1回に示す実施系の段 の方法で、基板収101上に空孔が任業の形成。 204は電低をあり、注意程度を104を 205は電低を35に、基礎を204間に回加さ れる電界により圧電票子は至み、液体に圧力を加 え、噴射孔202より液体は噴射される。本実施 例のごとき液体噴射ペッドの構造とすることによ り、製造工程数は第1回実施例のそれより低減さ さらに高少留りで安価を液体噴射ペッドが実 現される。

第3回に、本発明の実施例における。空孔が4の 方向圧電膜により囲まれている液体嗅性の一番 等は第1回と同一のものを表す。まず異常30日 101上にP2T等により形式の上電質30日 101上にP2T等により、近年電膜30日 101上にP2T等により、近年電膜3日 101上にP2T等により、近年電度所列 60 102、第3日に電膜30日、空孔110日、電影反し、 第3回に下で上では、第2日に変形の 域が、第2日に電膜30日、2、20日に 域が、101日に 第3日に対して 101日に 101日

#### [発明の効果]

以上述べたごとく本発明を用いることにより、 フォトリソグラフィー技術により液体導通路や圧 電景子等を連携的に形成するため、ノズルの高密 度化やマルチノズル化が容易な液体・収割でいます。 実現され、また圧電素子と圧力変との位置すれが おわのて小さくできるため、高歩部りの液体収割 ヘッドが実現される。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回(a)~(d)は、本発明の実施的における液体嗅射ヘッドの製造工程膜の新面図。 四回(a)は空孔形成パターン形成工程株下内。(b)は空孔形成工程株下降。(c)は液体噴射ヘッドを立ちの変孔形成工程株下時における液体噴射ヘッドの空孔形成工程株下時における液体噴射ヘッドの平面図の側、

第2回は、本発明の実施例における、圧電素子 電極を一層で形成した液体嗅射ヘッドの液体準道 を填射させることができる液体填射ヘッドが実現 \*\*\*

なお、本発明は以上述べた実施所のみならず、本発明の主旨を逸跋しない範囲において、広く 反用が可能である。また、本発明の強体項討ヘッドはインクジェットプリンタのみならず、他の印本、和謝装置(タイプライタ、コピー機出力等)や、登後後載、建築装置、建築装置等に広く適用される。

## 路に沿った新面図。

第3図は、本発明の実施例における、空孔が4 方向圧電膜により囲まれている液体噴射ヘッドの 断面図。

第4図は、本発明の実施例における、圧力室の 上下に圧電素子を設けた液体噴射ヘッドの液体準 通路に沿った新面図。

- 101…任意の基板
  - 102…空孔形成パターン
  - 103…第1の圧電機
  - 104…空孔
  - 105…電極
  - 106…第2の斤電機
  - 107…電板
  - 108…圧力室

以 上

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木喜三郎 (他1名)

